

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成30年2月1日(2018.2.1)

【公開番号】特開2015-143836(P2015-143836A)

【公開日】平成27年8月6日(2015.8.6)

【年通号数】公開・登録公報2015-050

【出願番号】特願2014-255021(P2014-255021)

【国際特許分類】

G 03 G 15/08 (2006.01)

G 03 G 9/08 (2006.01)

【F I】

G 03 G 15/08 2 3 5

G 03 G 9/08 3 7 5

【手続補正書】

【提出日】平成29年12月12日(2017.12.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0086

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0086】

(式4) 理論被覆率X2(面積%) = $3^{1/2} / (2\pi) \times (d_t / d_a) \times (t / a) \times C \times 100$

(式4)において、

d_a : シリカ微粒子の一次粒子の個数平均粒径(D1)、

d_t : トナーの質量平均粒径(D4)、

a : シリカ微粒子の真比重、

t : トナーの真比重、

C : シリカ微粒子の質量/トナーの質量

(Cは後述するトナー中のシリカ微粒子の含有量を用いる。)、である。